



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种降低背孔工艺中对等离子体刻蚀机腔体污染的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201410005319.3
申请日期:	2014-01-06
专利号:	201410005319.3
第一发明人:	魏珂;刘果果;孔欣;樊捷;黄森;刘新宇
实施情况:	授权
专利证书号:	201410005319.3
其它备注:	高频高压中心

